# XRR 解析レポート

### プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

#### 解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451

2θ(°):開始 = 0.200, 終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)|

ステップ = 0.004

オフセット=0.000e+000

フィッティング手法: 遺伝的アルゴリズム データ間隔:1点ごとにフィッティング

母集団: 50 個体数: 50

ターゲットχ²: 1.00e-004

重み: 50%

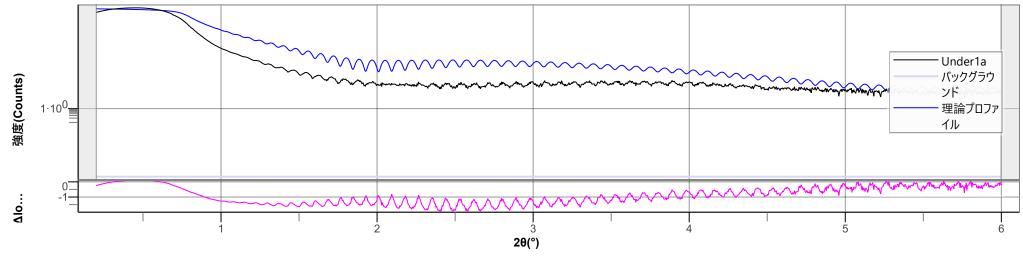
クロスオーバー: 50%

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00

ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

## 結果

#### プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼ 材料		膜厚(nm)			密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>	
	$\checkmark$	L2	Fe2O3		2.522	Const	4.95000	Const	0.211	Con
				±8		精密化		Const	±0.02	精密化
	$\checkmark$	L1	* * • Fe		92.531	Const	7.97400	Const	0.390	Con
				±0.6		精密化		Const	±0.05	精密化
	$\checkmark$	基板	<b>⊡</b> Si		00		2.32924	Const	0.500	Con